

# 固体電解質／電極界面の 界面抵抗発生起源の解明

東北大AIMR 白木将、鈴木竜、河底秀幸

産業技術総合研究所 白澤徹郎

東工大理工 一杉太郎、清水亮太

## 1. 研究背景

研究の狙い(全固体電池における電解質/電極界面抵抗の低減)

全真空プロセス(PLD、スパッタ、真空蒸着)を用いた

全固体薄膜電池の作製とイオン伝導評価

## 2. PLDによる $\text{Li}_3\text{PO}_4$ 電解質薄膜の作製

インピーダンス計測による電解質/電極界面抵抗評価

レーザー繰り返し周波数(成膜率)と界面抵抗

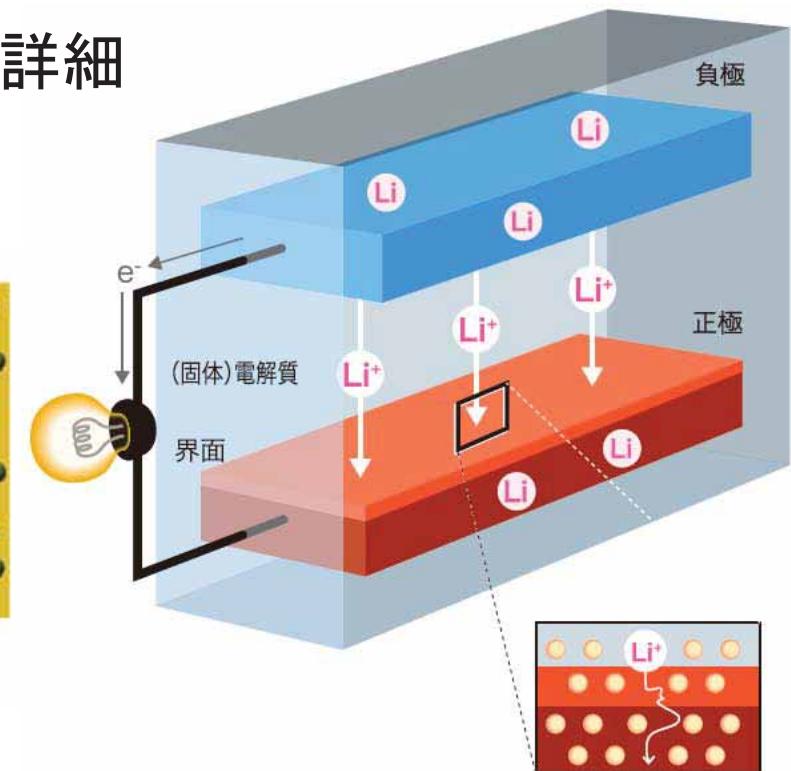
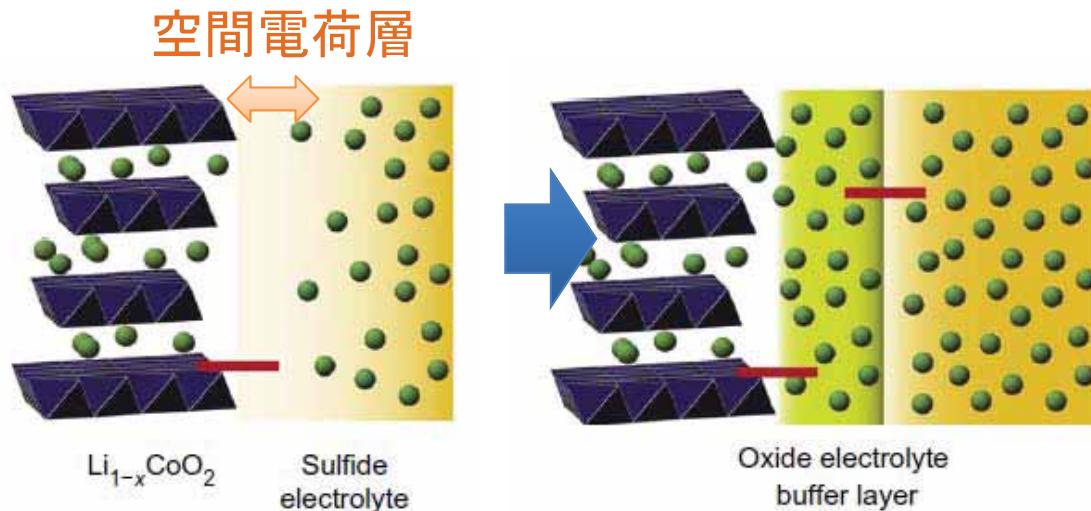
## 3. 表面X線回折、CTR散乱法による界面構造評価

## 4. 考察とまとめ

# 研究背景

## 全固体電池の開発課題

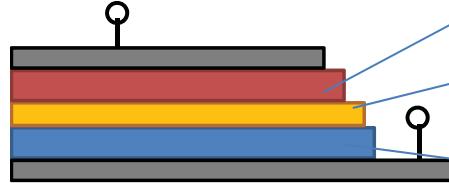
- ◆ 高いイオン伝導性を示す活物質、電解質の材料開発
- ◆ 電解質/電極界面における高い界面抵抗
  - ・空間電荷層の影響
  - ・バッファー層による界面抵抗の低減
- ◆ 界面におけるイオン伝導機構の詳細
- ◆ 界面抵抗低減への指針



Takada et al., Acta Materialia (2013)

# 薄膜型リチウムイオン電池

薄膜型全固体電池

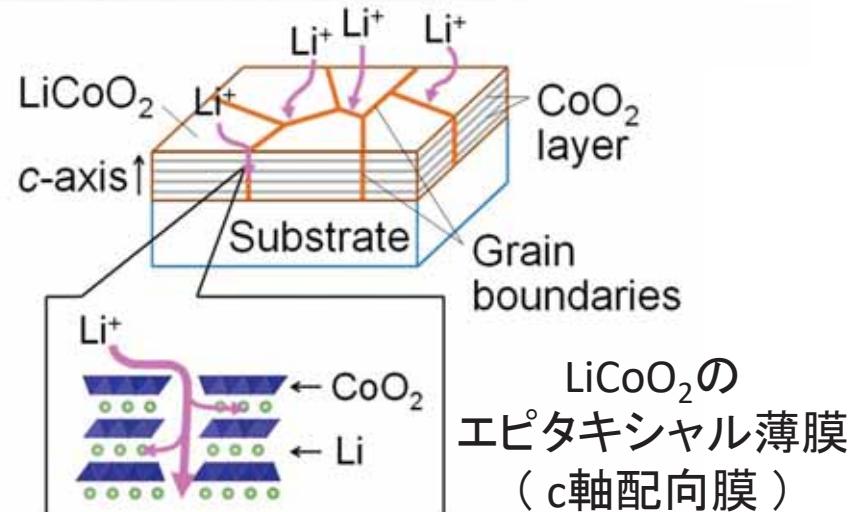


負極活物質

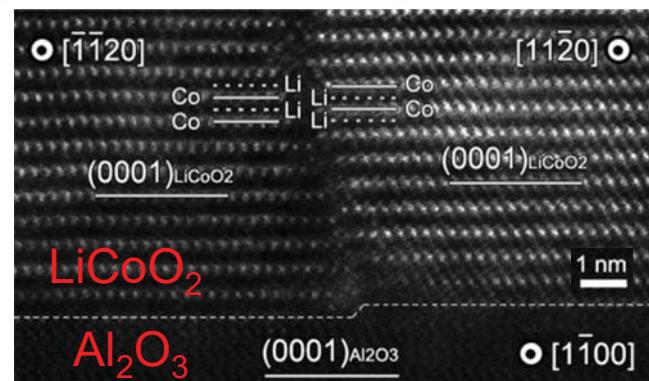
固体電解質

正極活物質

- ✓ 理想的な界面を形成し、定量評価
  - ◆ 構造を規定(イオン伝導経路を規定)  
(接合面積、結晶構造、結晶方位を規定)
  - ◆ 清浄な界面を形成  
(大気暴露による $H_2O$ 、 $CO_2$ などの付着を防ぐ)



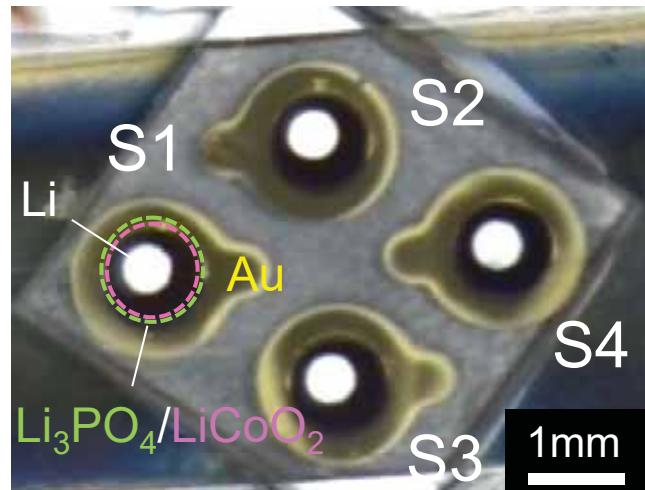
LiCoO<sub>2</sub>の  
エピタキシャル薄膜  
(c軸配向膜)



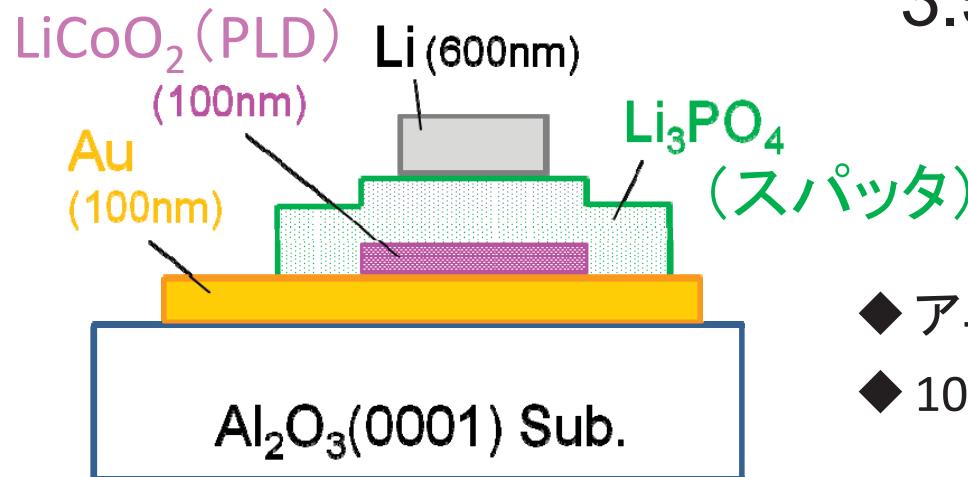
## 戦略

- ◆ エピタキシャル薄膜の利用により**構造を規定**した電解質/電極界面
- ◆ 全真空プロセスによる**清浄な**電解質/電極界面を作製
- ◆ 電解質/電極界面におけるイオン伝導の**定量評価**

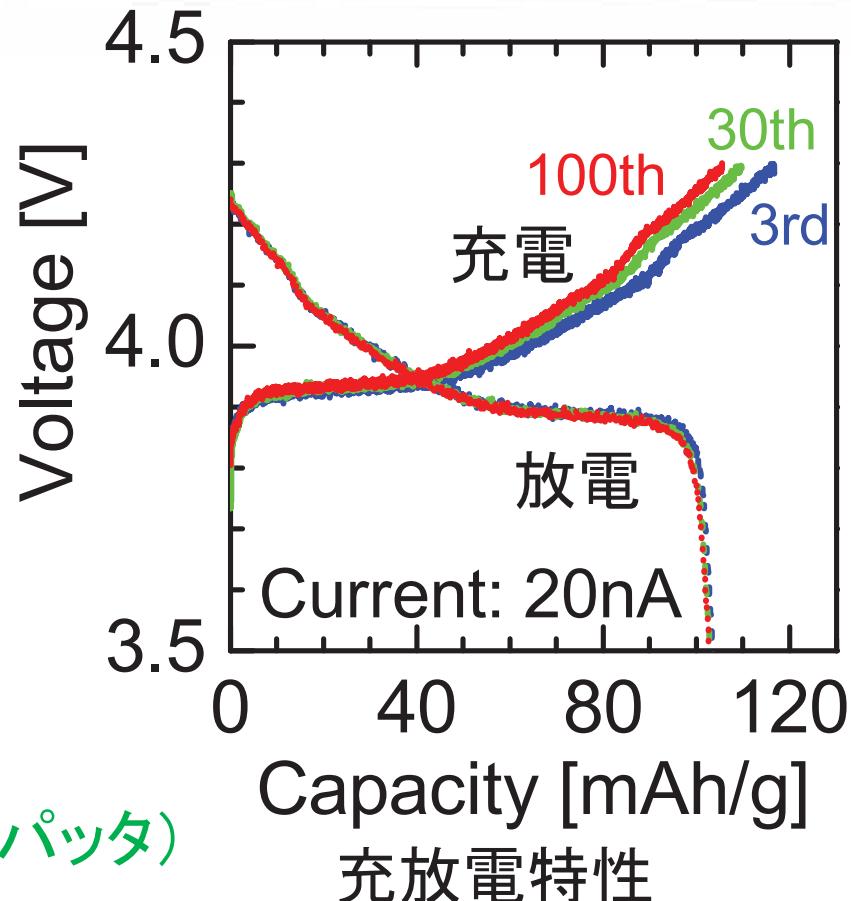
# 全固体薄膜電池( $\text{LiCoO}_2/\text{Li}_3\text{PO}_4/\text{Li}$ )



Active area:  $0.25 \times 0.25 \times \pi \text{ mm}^2$

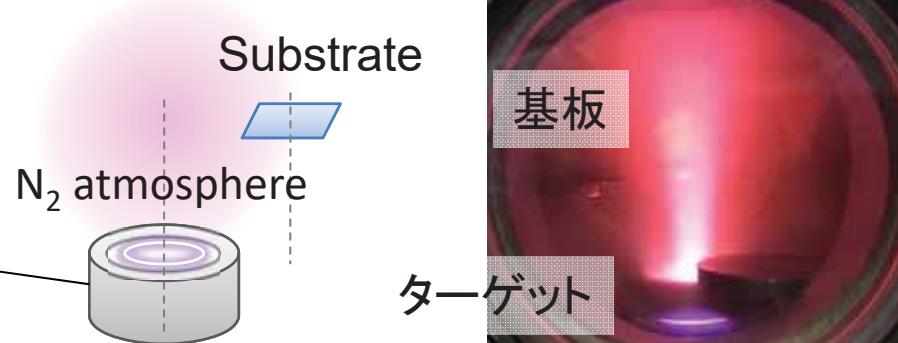
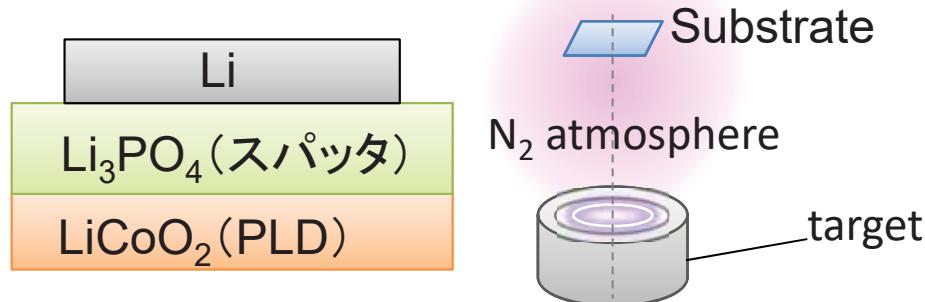
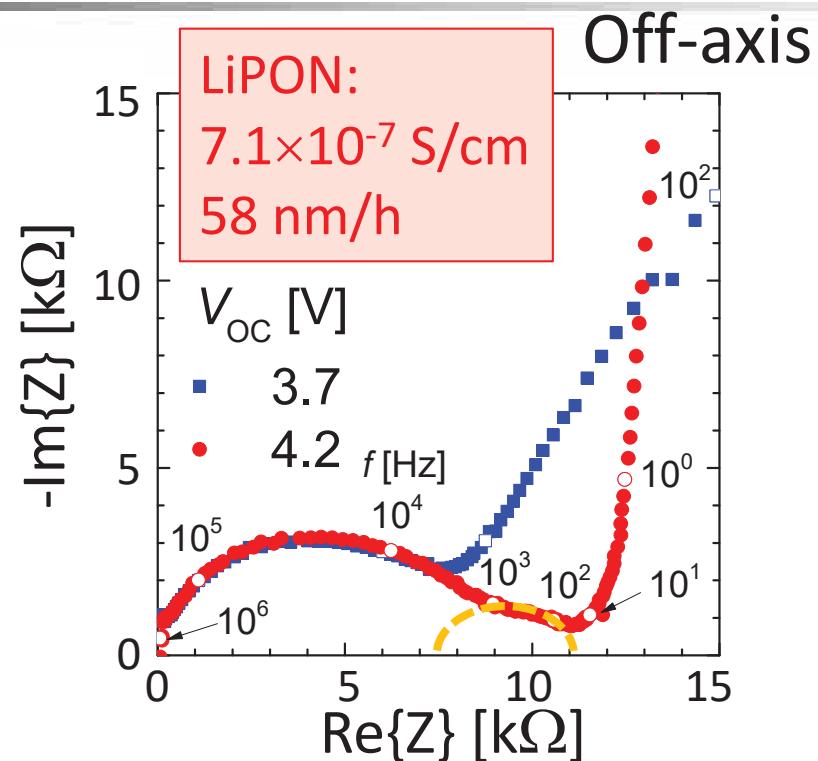
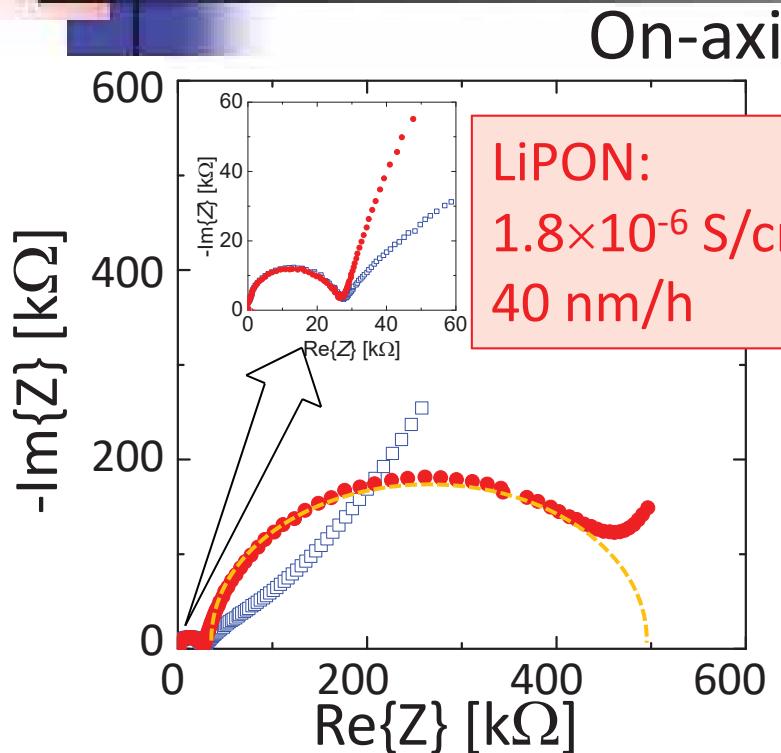


素子構造断面図



- ◆ アニール処理無しで良好な電池動作
- ◆ 100サイクルで容量劣化なし

# 基板-ターゲット配置の界面抵抗への影響



## スパッタを用いた電解質成膜の実験で得られた知見

- ・成膜時の電極表面へのダメージ低減により界面抵抗減少
- ・電解質/電極界面が清浄かつ構造の乱れがないことが鍵

## 本研究の取り組み

### 制御性の良い固体電解質薄膜作製、界面形成

- ・成膜時のガス導入(酸素、アルゴンなど)
- ・レーザー繰り返し周波数(成膜速度)

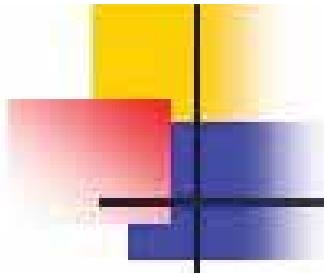


$\text{Li}_3\text{PO}_4$  の PLD 成膜 (界面抵抗 :  $125 \Omega\text{cm}^2$ ) Kuwata et al., J. Electro. Soc. (2015)

## 本研究の目的

PLD で 固体電解質薄膜を作製し、全固体薄膜電池の電池動作と電解質/電極界面におけるイオン伝導特性を定量評価、さらにレーザー繰り返し周波数等の成膜プロセスの界面抵抗、界面構造への影響

# 薄膜電池作製方法



## ◆作製方法

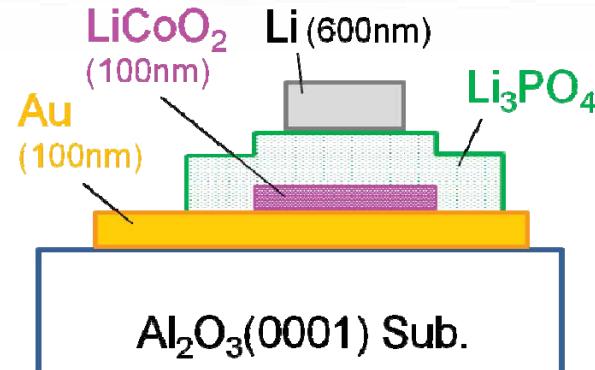
### ① 集電体 : Au

- ・作製方法 DCスパッタ法
- ・基板温度 室温
- ・ポストアニール 600°C, 10min
- ・膜厚 100 nm

### ② 正極活物質 : LiCoO<sub>2</sub>(LCO)

- ・作製方法 PLD法 (KrF, 248 nm)
- ・ターゲット  $\text{Li}_{1.2}\text{CoO}_2$
- ・成膜雰囲気  $\text{O}_2$ , 0.13 Pa
- ・基板温度 450°C
- ・レーザ条件  
エネルギー密度 1 J/cm<sup>2</sup>  
繰り返し周波数 5 Hz  
・膜厚 100 nm

( XRDによりc軸配向膜を確認)



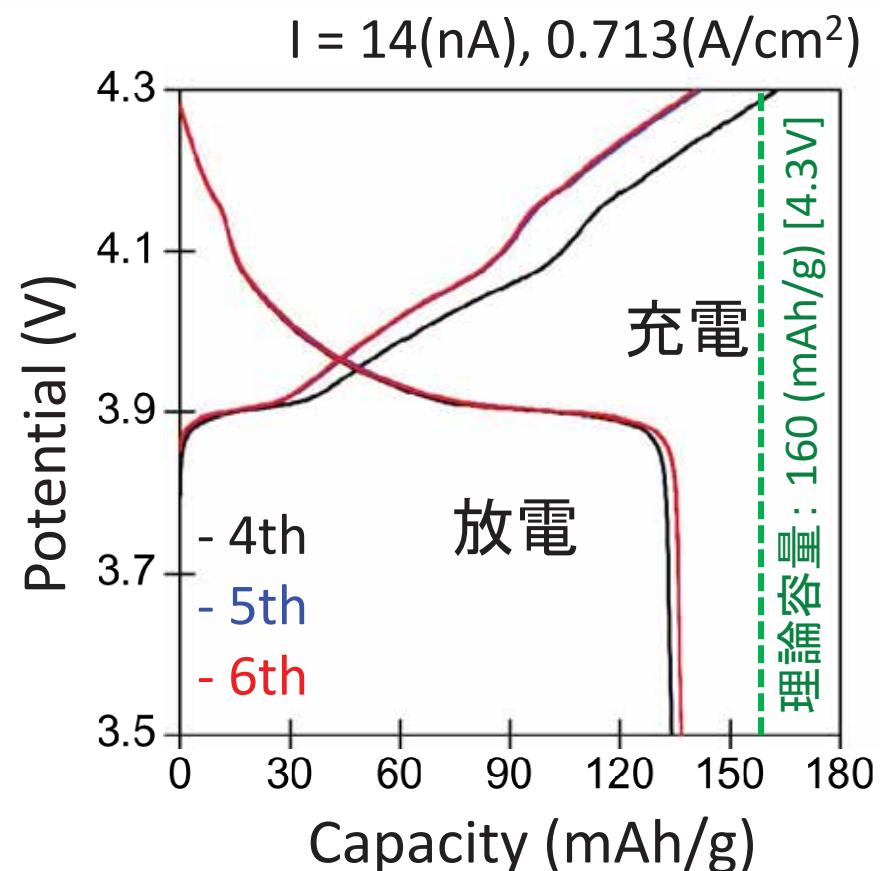
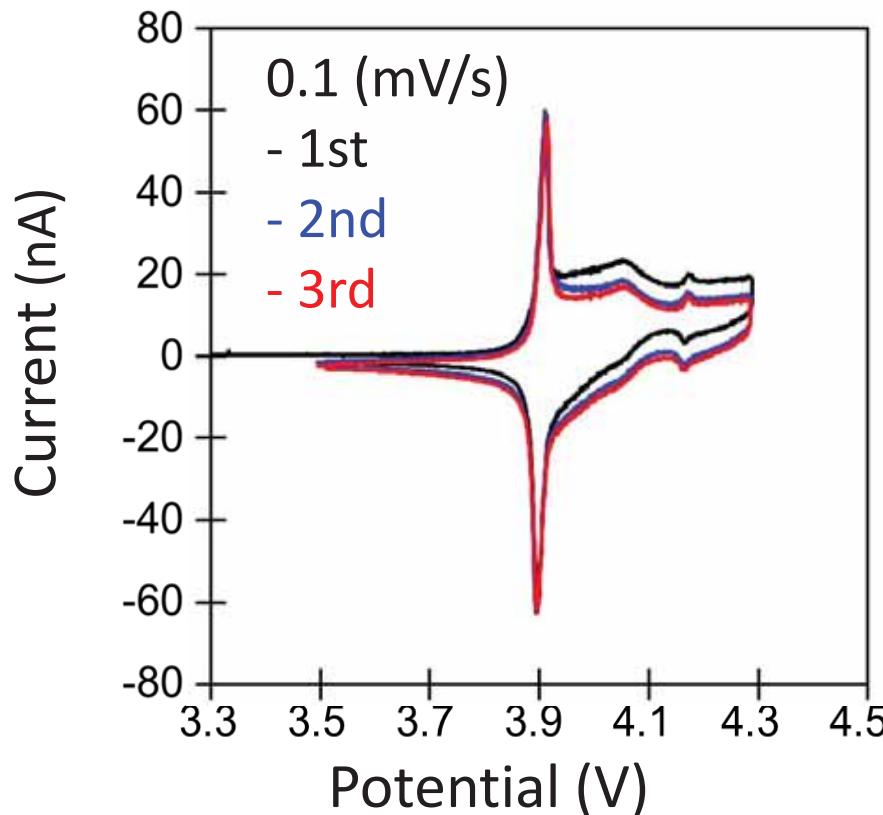
### ③ 固体電解質 : Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>

- ・作製方法 PLD法 (ArF,  $\lambda=193$  nm)
- ・ターゲット  $\text{Li}_3\text{PO}_4$
- ・成膜雰囲気 真空、アルゴン、酸素 (~1x10<sup>-2</sup> Torr)
- ・基板温度 室温
- ・レーザ条件  
エネルギー密度 1 J/cm<sup>2</sup>  
繰り返し周波数 5 Hz, 20 Hz
- ・膜厚 250 nm

### ④ 負極活物質 : Li

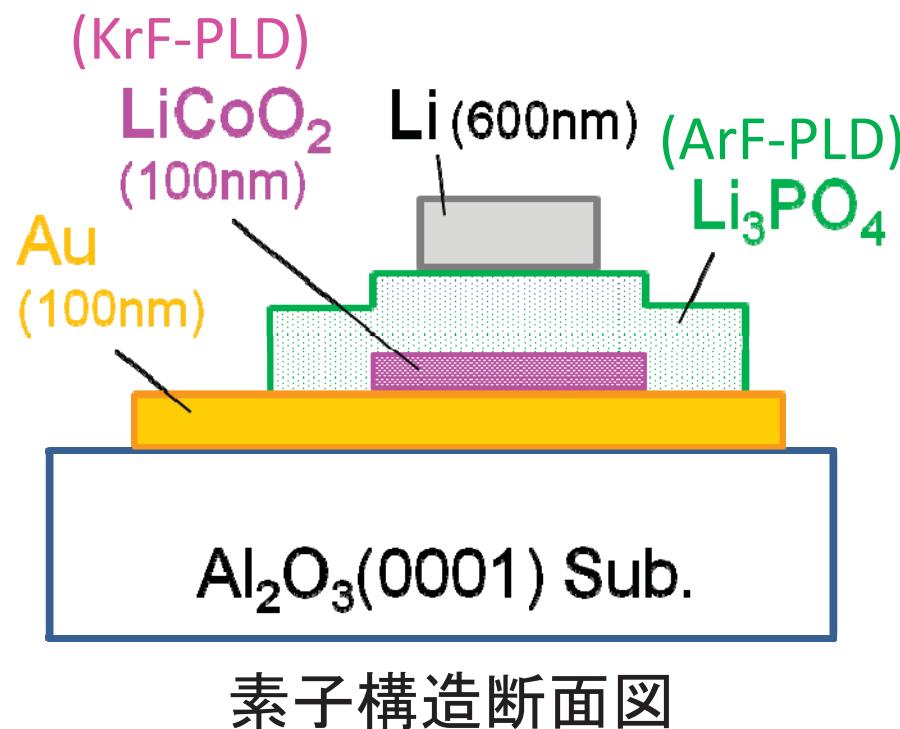
- ・作製方法 真空加熱蒸着法
- ・膜厚 500~600 nm

# 薄膜電池の充放電特性(5 Hz)

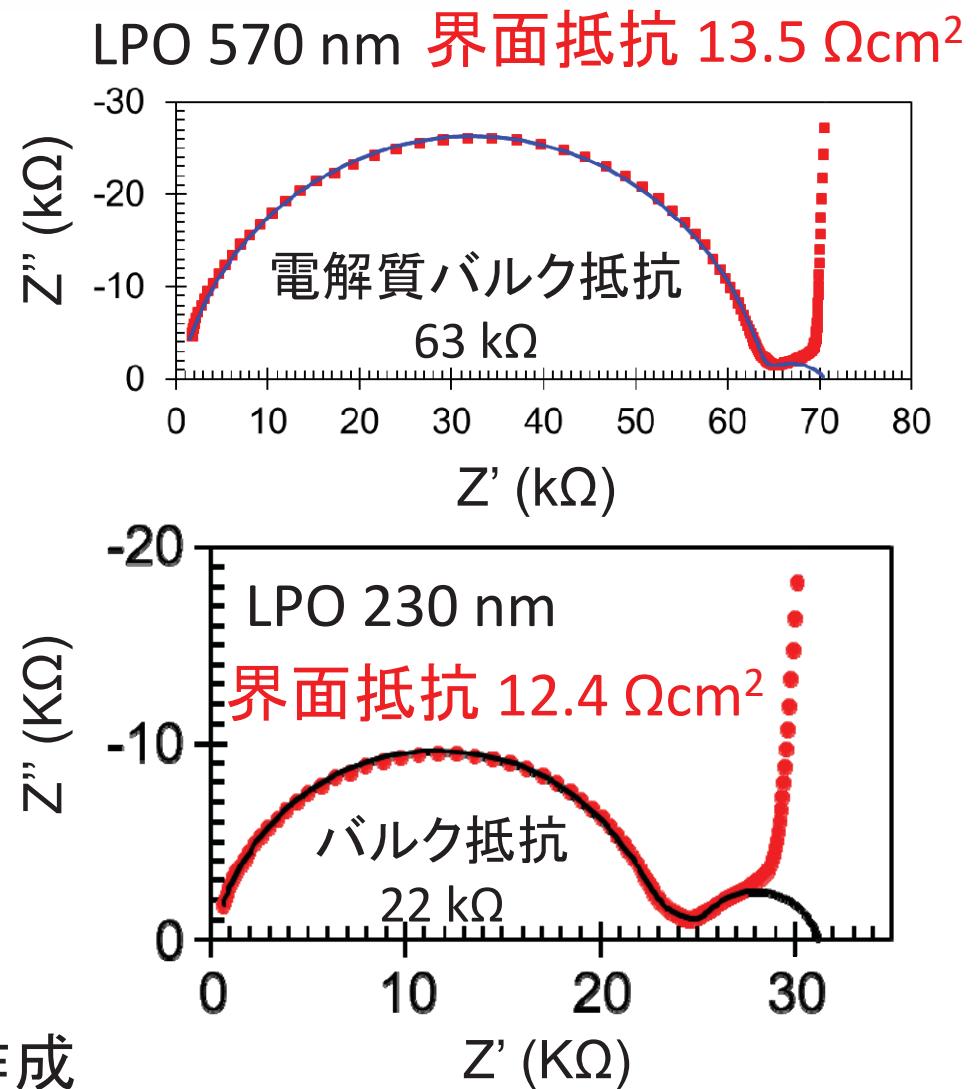


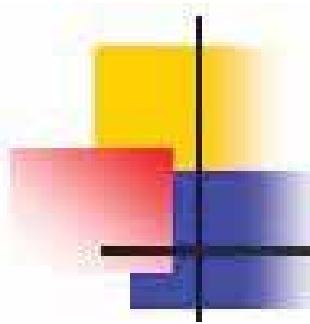
◆PLDで成膜した固体電解質 $\text{Li}_3\text{PO}_4$ で良好な電池動作

# 界面抵抗評価(5 Hz)

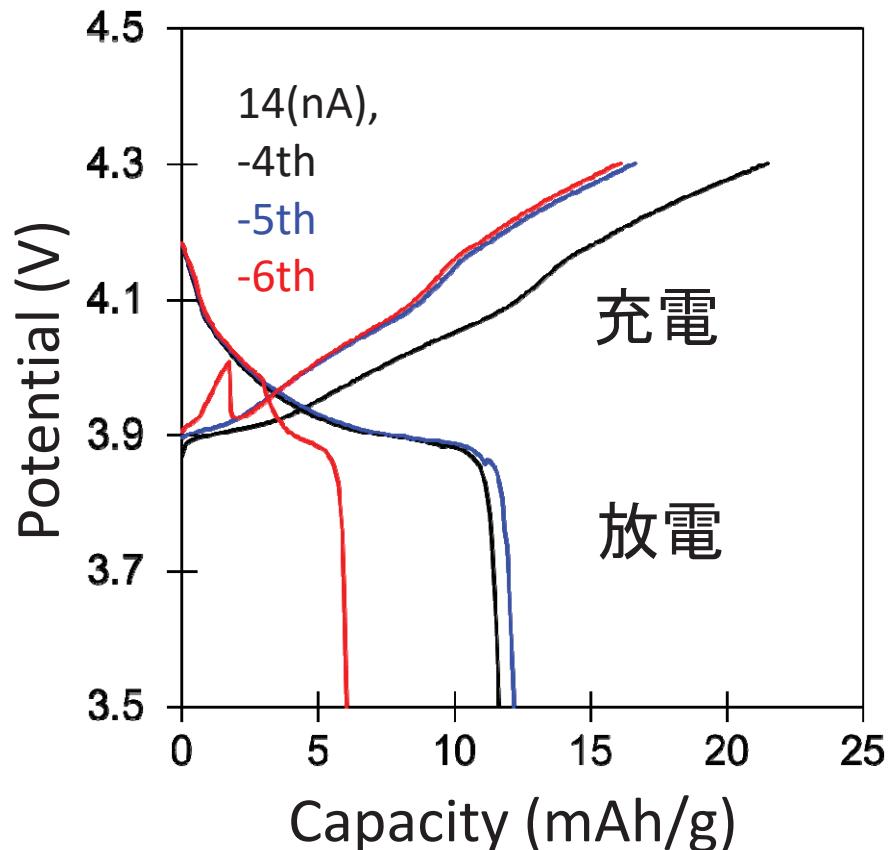
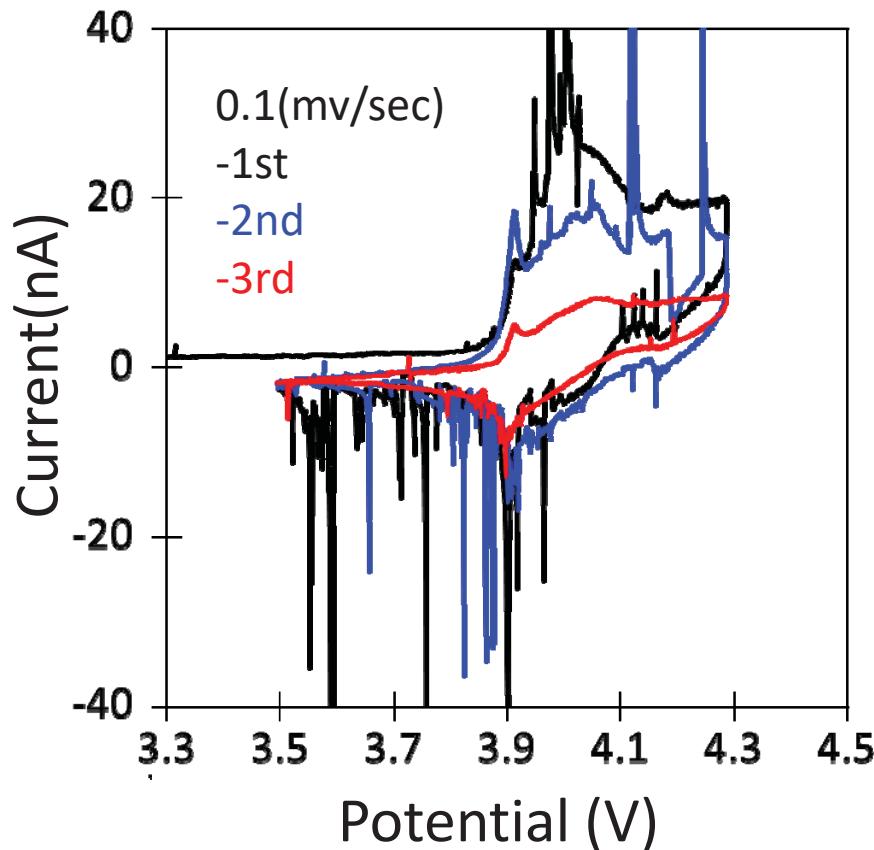


全固体電池において  
極めて抵抗の低い固固界面を作成



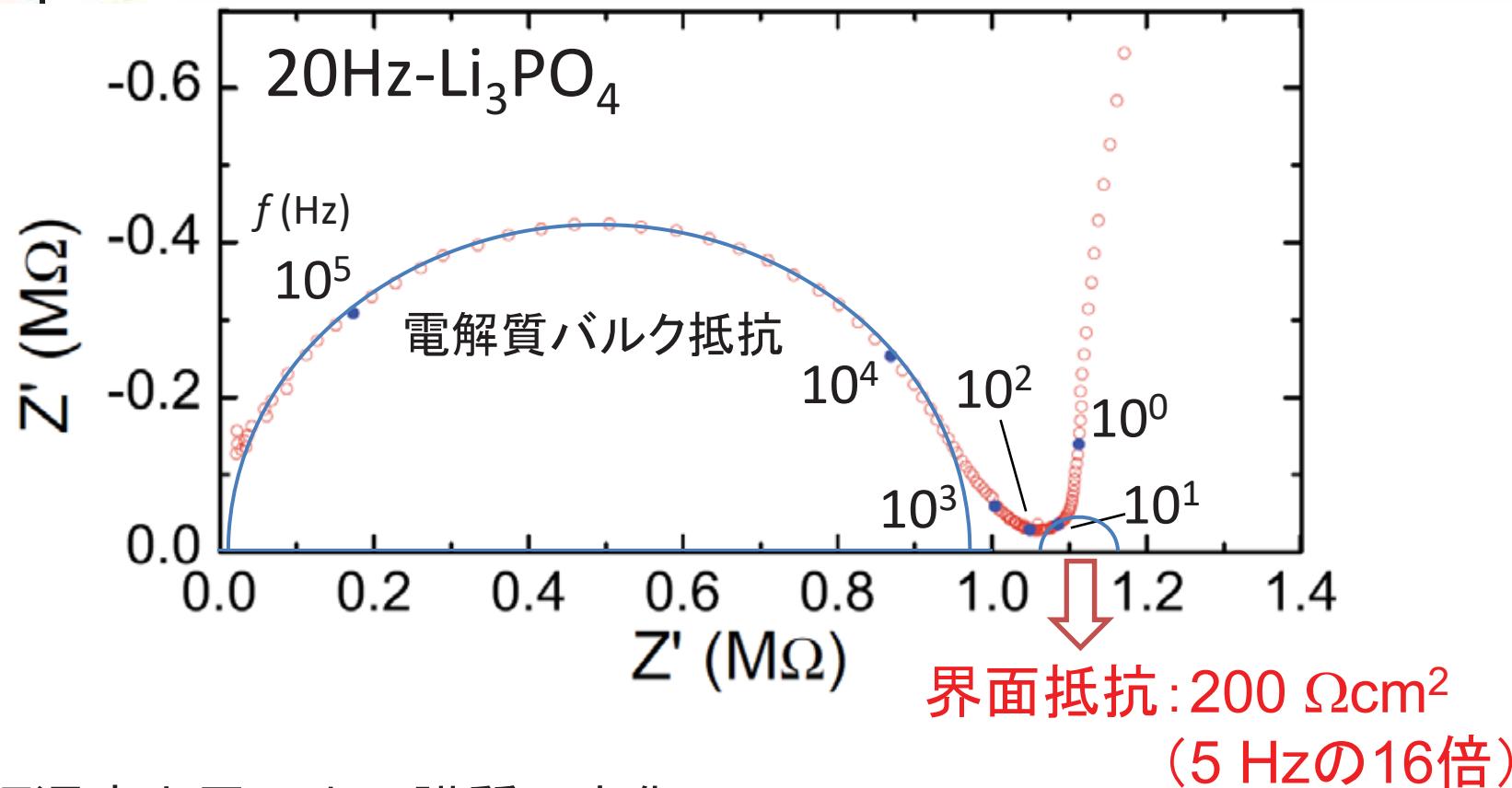


# 薄膜電池の充放電特性(20 Hz)



◆周波数20 Hzで成膜した固体電解質Li<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>では電池動作が不安定

# 界面抵抗評価(20 Hz)



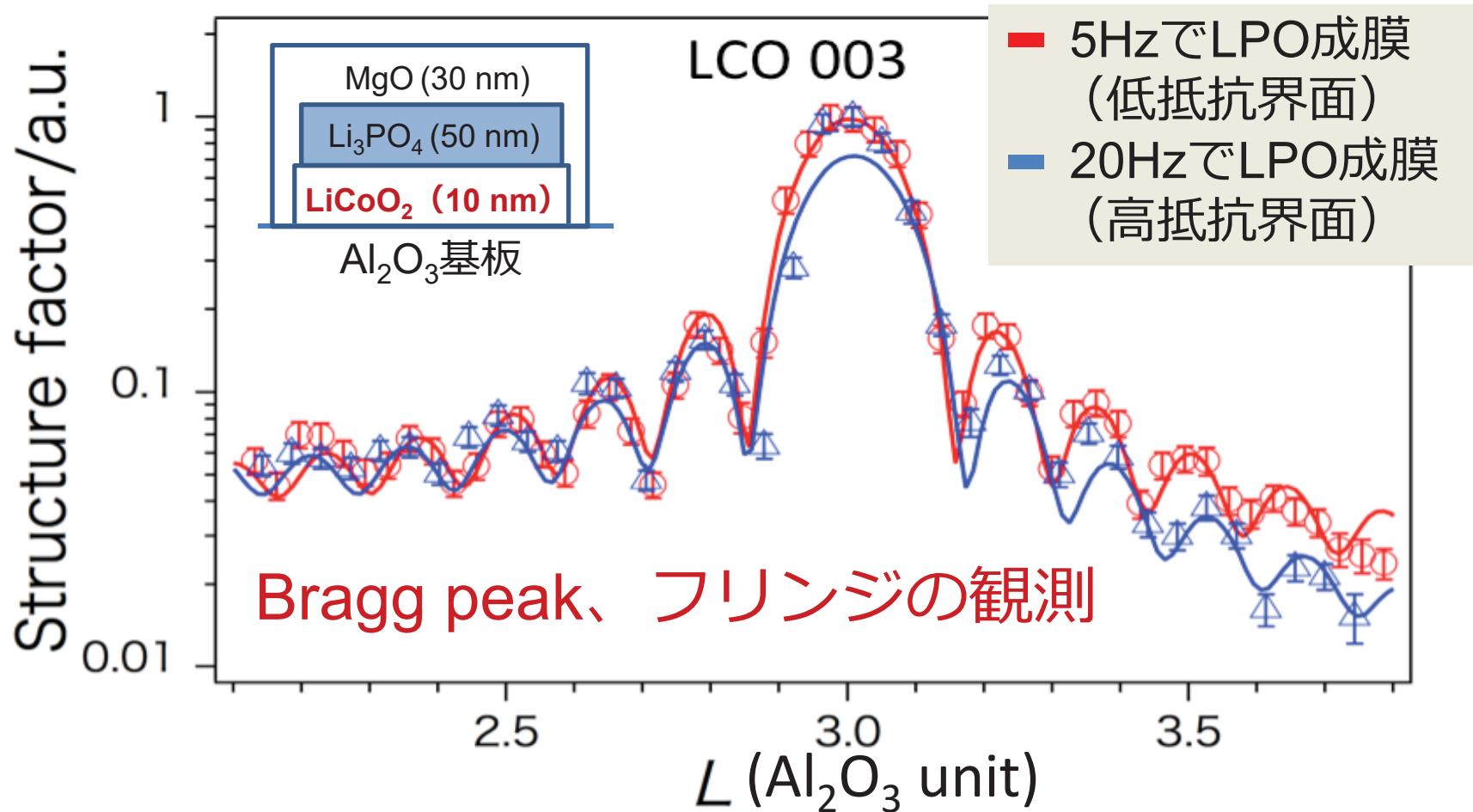
- ・基板温度上昇による膜質の変化
- ・薄膜、界面の緻密性
- ・界面ダメージの変化



放射光を用いた表面X線回折で  
界面構造を評価

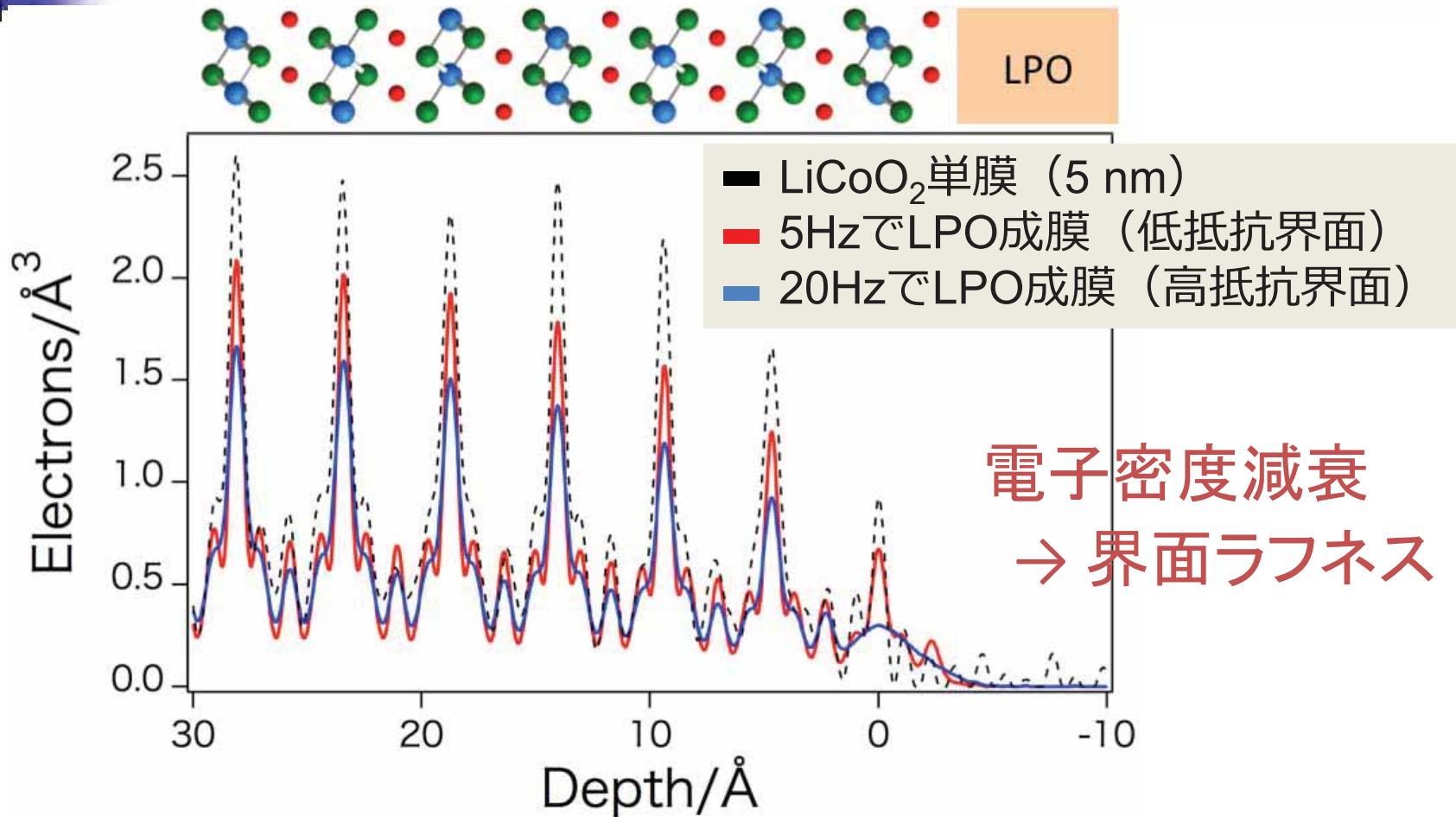
# 電極/電解質界面の構造評価

放射光表面X線回折(産総研・白澤徹郎博士)

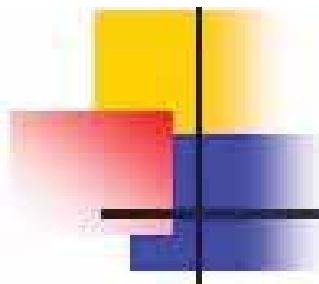


Bragg peak周りの大きな /で強度減衰→原子配列の乱れ

# 界面の構造評価（電子密度分布）

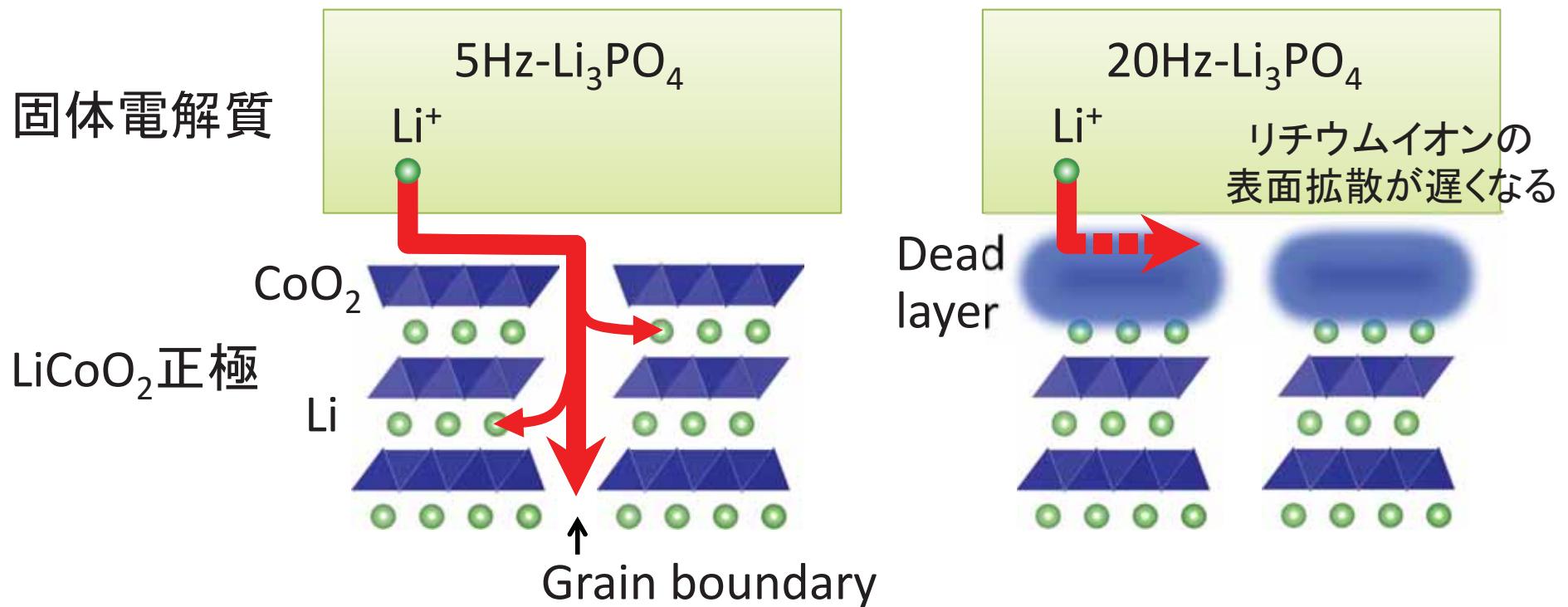


低抵抗界面では  
LCO表面が平坦で原子配列がより規則的

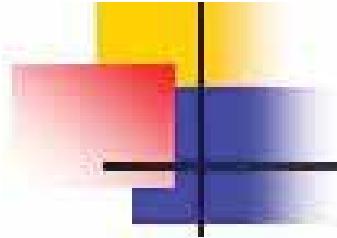


# 電極表面構造と界面抵抗

$\text{LiCoO}_2$ は2次元イオン伝導体のため、粒界を通りバルク内をLiが拡散



LCO表面の原子配列が乱れると、リチウムイオンの表面拡散が遅くなり、界面抵抗を増大



# まとめ

PLDで製膜した固体電解質 $\text{Li}_3\text{PO}_4$ 薄膜を用いて  
薄膜型の全固体リチウムイオン二次電池を作製した

- ・速い成膜レートで電解質を作製 (248 nm/h、スパッタの4倍強)
- ・全固体薄膜電池の安定な電池動作
- ・低い電解質/電極界面抵抗の形成に成功 ( $12.4 \Omega\text{cm}^2$ )
- ・成膜条件の違いにより電解質/電極界面抵抗が変化



- ・PLDによりダメージの少ない良好な電解質/電極界面の形成
- ・界面抵抗は電解質と電極材料の組み合わせだけでは決まらない
- ・低抵抗界面では界面が平坦かつ原子配列がより規則的  
→ 電極( $\text{LiCoO}_2$ )表面でのリチウム拡散が界面抵抗に影響

本研究はトヨタ自動車、NEDO、JST-ALCA、JST-CREST、科研費の支援を受け行われた。